PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-162713

(43)Date of publication of application: 07.06.2002

(51)Int.CI.

G03C 1/76 G03C 1/498 G03C 1/74

(21)Application number: 2000-359050

(71)Applicant : KONICA CORP

(22)Date of filing:

27.11.2000

(72)Inventor: GOTO SHIGETO

(54) HEAT DEVELOPABLE PHOTOSENSITIVE MATERIAL AND ITS PROCESSING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat developable photosensitive material which is good in black spots and fogging, excellent in adhesiveness, high in Dmax and contrasty, and its processing method. SOLUTION: The processing method of the heat developable photosensitive material is characterized in that the heat developable photosensitive material, which has an image recording layer containing an organic acid silver, a silver halide, a binder, and a reducing agent on a supporting body, a back coating layer on the other face of the supporting body, and contains a polyurethane or a polyester of which the glass transition temperature (Tg) is -40° C to 50° C as the binder in the image recording layer or in the back coating layer, is processed by a heat developer at a conveying speed of 22 to 40 mm/sec.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-162713

(P2002-162713A) (43)公開日 平成14年6月7日(2002.6.7)

(51) Int. C1. 7 G03C 1/76 1/498	. 7	識別記号	FΙ			テーマコート・	(参考)
G03C	1/76	351	G03C	1/76	351	2H123	
	1/498	501		1/498	501		
	1/74	351		1/74	351		

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全29頁)

(21) 出願番号 特願2000-359050(P2000-359050) (71) 出願人 000001270 コニカ株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 (72)発明者 後藤 成人 東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 社内 Fターム(参考) 2H123 AB00 AB03 AB23 AB28 BA00 BA12 BA14 BA16 BA45 BA48 BC00 BC01 CB00 CB03 CB20

(54) 【発明の名称】熱現像感光材料及びその処理方法

(57)【要約】

【課題】 黒ポツやカブリが良好で接着性に優れ、Dmaxが高く硬調な熱現像感光材料およびその処理方法を提供する。

【解決手段】 支持体上に、有機酸銀、ハロゲン化銀、バインダー、還元剤を含有する画像記録層を有し、支持体の他方の面にバックコート層を有し、かつ該画像記録層または該バックコート層中にバインダーとしてガラス転移温度(Tg)が-40 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に、有機酸銀、ハロゲン化銀、バインダー、還元剤を含有する画像記録層を有し、支持体の他方の面にバックコート層を有し、かつ該画像記録層または該バックコート層中にバインダーとしてガラス転移温度(Tg)が-40℃~50℃のポリウレタンまたはポリエステルを含有する熱現像感光材料を、熱現像機の搬送速度が22mm/sec以上40mm/sec以下で処理することを特徴とする熱現像感光材料の処理方法。

【請求項2】 支持体上に、有機酸銀、ハロゲン化銀、バインダー、還元剤を含有する画像記録層を有し、支持体の他方の面にバックコート層を有し、かつ該画像記録層または該バックコート層中にバインダーとして脂肪族ポリエステルポリウレタンを含有する熱現像感光材料を、熱現像機の搬送速度が22mm/sec以上40mm/sec以下で処理することを特徴とする熱現像感光材料の処理方法。

【請求項3】 パインダーが、 $-SO_1M$ 、 $-OSO_1M$ 、 $-PO(OM_1)$ 、および $-OPO(OM_1)$ 、 、(ここに、Mは水素原子又はアルカリ金属を、M、は水素原子、アルカリ金属を表す)から選ばれる少なくとも 1種の極性基を有することを特徴とする請求項1又は2 記載の熱現像感光材料の処理方法。

【請求項4】 バインダーがポリカプロラクトンを含有するポリエステルポリウレタンであることを特徴とする請求項1又は2記載の熱現像感光材料の処理方法。

【請求項5】 支持体上に、有機酸銀、ハロゲン化銀、バインダー、選元剤を含有する画像記録層を有し、支持体の他方の面にバックコート層を有し、かつ該画像記録 30層または該バックコート層中にパインダーとしてガラス転移温度(Tg)が-40℃~50℃のポリウレタンまたはポリエステルを含有する熱現像感光材料において、支持体と該画像記録層および支持体と該バックコート層の少なくとも一方の間に下引き層を有し、該下引き層中にアクリル樹脂、ポリウレタン、ポリエステルから選ばれる少なくとも1種のバインダーを含有することを特徴とする熱現像感光材料。

【請求項6】 請求項5記載の熱現像感光材料を、画像記録層の全バインダーの50質量%以上がポリマーラテ 40ックスであり、溶媒の30質量%以上が水である塗布液を支持体上に塗布乾燥して製造することを特徴とする熱現像感光材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、熱現像感光材料及びその処理方法に関し、更に詳しくは、支持体との接着性に優れ、Dmaxが高く、硬調な熱現像感光材料及びその処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来印刷製版や医療の分野では、画像形 成材料の湿式処理に伴う廃液が、作業性の上で問題とな っており、近年では環境保全、省スペースの観点からも 処理廃液の減量が強く望まれている。そこで、レーザー イメージセッターやレーザー・イメージャーにより効 率的な露光が可能で、高解像度で鮮明な黒色画像を形成 することができる写真用途の光熱写真材料に関する技術 が必要とされている。この技術として、例えば、米国特 許第3, 152, 904号、同3, 487, 075号及 10 びD. モーガン (Morgan) による「ドライシルバ 一写真材料 (Dry Silver Photogra phic Materials) | (Handbook of Imaging Materials, Ma rcelDekker, Inc. 第48頁, 1991) 等に記載されているように、支持体上に有機銀塩、感光 性ハロゲン化銀粒子、還元剤及びバインダーを含有する 熱現像感光材料が知られている。

【0003】これらの熱現像感光材料は、熱現像処理にて写真画像を形成するもので、還元可能な銀源(有機銀20塩)、感光性ハロゲン化銀、還元剤及び必要に応じて銀の色調を抑制する色調剤を通常(有機)バインダーマトリックス中に分散した状態で含有している。該熱現像感光材料は常温で安定であるが、露光後高温(例えば、80℃~140℃)に加熱することで現像される。加熱することで有機銀塩(酸化剤として機能する)と還元剤との間の酸化還元反応を通じて銀を生成する。この酸化還元反応は露光でハロゲン化銀に発生した潜像の触媒作用によって促進される。露光領域中の有機銀塩の反応によって生成した銀は黒色画像を提供し、これは非露光領域30と対照をなし、画像の形成がなされる。この反応過程は、外部から水等の処理液を供給することなしで進行する。

【0004】このような熱現像感光材料は、マイクロ感光材料やレントゲン感光材料には使われてきたが、印刷感光材料としては一部で使われているのみである。それは、得られる画像のDmaxが低く、階調が軟調なために、印刷感光材料としては画質が著しく悪いからであった。

【0005】一方、近年レーザーや発光ダイオードの発達により、600~800nmに発振波長を有するスキャナー適性を有する、感度、Dmaxが高く、かつ硬調な感光材料の開発が強く望まれていた。また、簡易処理、ドライ化への要望も強くなっている。

【0006】ところで、米国特許第3,667,958号には、ポリヒドロキシベンゼン類とヒドロキシルアミン類、レダクトン類またはヒドラジン類を併用した熱現像感光材料は高い画質識別性と解像力を有することが記載されているが、この還元剤の組み合わせはカブリの上昇を引き起こしやすいことがわかった。

50 【0007】また、米国特許5,464,738号や同

5. 496. 695号には、有機銀塩、ハロゲン化銀、 ヒンダードフェノール類、およびある種のヒドラジン誘 導体を含む熱現像感光材料が開示されている。しかし、 これらのヒドラジン誘導体を用いた場合には、十分満足 なDmax、あるいは超硬調性が得られず、また、黒ポ ツが発生して画質が悪化してしまうという問題がある。

【0008】また、黒ポツを改良したヒドラジン誘導体 として特開平9-292671号、同9-304870 号、同9-304871号、同9-304872号、同 10-31282号等で開示されている。さらに画像の 10 再現性を改善したヒドラジン誘導体として特開平10-62898号で記載されているが、最高到達濃度、超硬 調性、黒ポツの改良、小点再現性、寸法安定性のすべて を満足するには至っていない。また、上記特許で開示さ れたヒドラジン誘導体は経時での保存性(カブリ上昇) が悪いという問題があった。

【0009】また近年、処理の迅速化の必要性が高まっ てきているが、従来の技術では黒ポツの発生が多かった り、カブリが上昇するという問題点があり、解決する技 術が望まれている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、迅速 処理を行った場合でも、黒ポツの発生がなく、カブリの 上昇も少なく、支持体との接着性に優れ、Dmaxが高 く、硬調な熱現像感光材料を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明の上記目的は、以 下の構成によって達成された。

【0012】1. 支持体上に、有機酸銀、ハロゲン化 銀、バインダー、還元剤を含有する画像記録層を有し、 支持体の他方の面にバックコート層を有し、かつ該画像 記録層または該バックコート層中にバインダーとしてガ ラス転移温度(Tg)が-40℃~50℃のポリウレタ ンまたはポリエステルを含有する熱現像感光材料を、熱 現像機の搬送速度が22mm/sec以上40mm/s e c 以下で処理することを特徴とする熱現像感光材料の 処理方法。

【0013】2. 支持体上に、有機酸銀、ハロゲン化 銀、パインダー、還元剤を含有する画像記録層を有し、 支持体の他方の面にバックコート層を有し、かつ該画像 40 記録層または該バックコート層中にバインダーとして脂 肪族ポリエステルポリウレタンを含有する熱現像感光材 料を、熱現像機の搬送速度が22mm/sec以上40 mm/sec以下で処理することを特徴とする熱現像感 光材料の処理方法。

【0014】3. バインダーが、-SO, M、-OSO, M, $-PO(OM_1)$, $3kU-OPO(OM_1)$, (2 こに、Mは水素原子又はアルカリ金属を、M, は水素原 子、アルカリ金属を表す)から選ばれる少なくとも1種 の極性基を有することを特徴とする前記1又は2記載の 50 シアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート等特開平

熱現像感光材料の処理方法。

【0015】4. バインダーがポリカプロラクトンを含 有するポリエステルポリウレタンであることを特徴とす る前記1又は2記載の熱現像感光材料の処理方法。

【0016】5. 支持体上に、有機酸銀、ハロゲン化 銀、バインダー、還元剤を含有する画像記録層を有し、 支持体の他方の面にバックコート層を有し、かつ該画像 記録層または該バックコート層中にバインダーとしてガ ラス転移温度(Tg)が-40℃~50℃のポリウレタ ンまたはポリエステルを含有する熱現像感光材料におい て、支持体と該画像記録層および支持体と該バックコー ト層の少なくとも一方の間に下引き層を有し、該下引き 層中にアクリル樹脂、ポリウレタン、ポリエステルから 選ばれる少なくとも1種のバインダーを含有することを 特徴とする熱現像感光材料。

【0017】6. 前記5記載の熱現像感光材料を、画像 記録層の全バインダーの50質量%以上がポリマーラテ ックスであり、溶媒の30質量%以上が水である塗布液 を支持体上に塗布乾燥して製造することを特徴とする熱 現像感光材料の製造方法。

【0018】本発明を更に詳しく説明する。本発明にお いて、バインダーのガラス転移温度(Tg)を0℃~5 0℃、より好ましくは10℃~40℃とすることで本発 明の効果の中でも特に支持体と画像記録層との接着性を 著しく改善することができる。又、バインダーのガラス 転移温度(Tg)を-40℃~0℃、より好ましくは-30℃~-10℃とすることで本発明の効果の中でも特 にDmaxを著しく改善することができる。

【0019】本発明のガラス転移温度(Tg)が-40 30 C~50Cのポリウレタンまたはポリエステルでバイン ダーとして使用することのできる具体的化合物として、 脂肪族系ポリエステル含有ポリウレタン樹脂、例えば脂 肪族ポリエステルポリオールとポリイソシアネートとの 反応物を挙げることが出来る。

【0020】上記の脂肪族ポリエステルポリオールとし ては、マレイン酸、コハク酸、アジピン酸、セバシン酸 等の脂肪族系二塩基酸と、エチレングリコール、プロピ レングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレン グリコール等のグリコール類:トリメチロールエタン、 トリメチロールプロパン、ヘキサントリオール、グリセ リン、ペンタエリスリトール等の脂肪族系多価アルコー ル類;の中から選ばれるポリオールとの反応によって得 られるポリエステルポリオール、或は、γ-カプロラク トン、δ-カプロラクトン、ε-カプロラクトン、γ-プチロラクトン等のラクトン類から得られるポリエステ ルポリオール等が挙げられる。

【0021】一方、ポリイソシアネートについては脂肪 族系或は芳香族系のどちらであってもよく、トリレンジ イソシアネート、ジフェニルメタンー4,4′ージイソ

3-88119号公報2頁右上15行目~左下9行目に 挙げられるものを使用することができる。

【0022】本発明の請求項4に係るポリカプロラクト ンを含有するポリエステルポリウレタンは、通常のポリ ウレタン合成法と同様に、ポリカプロラクトンポリオー ル等の高分子量ポリオール(分子量500~3000) と多官能の芳香族、脂肪族イソシアネートを反応させて 合成する。髙分子ポリオールとしてはポリカプロラクト ンポリオール以外に通常のポリオール、即ちジオールと ジカルボン酸からなるポリオールが含まれてもよい。こ 10 れによって、ポリカプロラクトンポリウレタンが合成さ れる。

【0023】これらのポリウレタンは主として、ポリイ シアネートとポリオール及び必要に応じ他の共重合体と の反応で製造され、そして遊離イソシアネート基及び/ 又はヒドロキシル基を含有するウレタン樹脂又はウレタ ンプレポリマーの形でも、或いはこれらの反応性末端基 を含有しないもの(例えばウレタンエラストマーの形) であってもよい。

【0024】イソシアネート成分としては種々のジイソ 20 シアネート化合物、例えばヘキサメチレンジイソシアネ ート(HMDI)、ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)、水添化MDI(H₁₂MDI)、トルエンジ イソシアネート (TDI)、1,5-ナフタレンジイソ シアネート(NDI)、トリジンジイソシアネート(T ODI)、リジンジイソシアネートメチルエステル(L DI)、イソホロンジイソシアネート(IPDI)等が 使用できる。又必要に応じて、1,4-ブタンジオー ル、1,6ヘキサンジオール、1,3-ブタンジオール 等の低分子多官能アルコールを使用して、分子量の調 節、樹脂物性の調節等を行う。

【0025】変性のために導入する官能基は、イソシア ネート成分に導入することも考えられるが、ポリオール 成分に導入することもでき、更に、上記の低分子多官能 アルコール中に導入してもよいし、また陰性官能基を導 入したラクトン係ポリエステルポリオールを用いてもよ い。即ち δ -カプロラクトン、 α -メチル-1-カプロ ラクトン、δーメチルーδーカプロラクトン、γーブチ ロラクトン等のラクトン類に上記官能基を導入しておけ ばよい。

【0026】本発明において、ポリカプロラクトンを含 むモノマー成分のモル%は好ましくは10~50%、よ り好ましくは20~40%とすることで本発明の効果の 中でも特に支持体と画像記録層との接着性を著しく改善 することができる。

【0027】本発明において、上述した、ガラス転移温 度(Tg)が-40℃~50℃のポリウレタンまたはポ リエステル以外に、本発明の画像記録層、画像記録保護 層、バックコート層、下引き層に用いられるバインダー としては、特に制限はなく、例えば、疎水性樹脂及び親 50 のアルカリ金属原子又はアルキル基を表す)から選ばれ

水性樹脂のいずれでもよく、それぞれの適性に応じて使 い分けられる。

【0028】疎水性樹脂を用いた場合、熱現像後のカブ リを低減させる等の利点を有し、好ましい疎水性のバイ ンダーとしては、ポリビニルブチラール樹脂、セルロー スアセテート樹脂、セルロースアセテートプチレート樹 脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリア クリル樹脂、ポリウレタン樹脂、塩化ビニル樹脂等が挙 げられる。その中でもポリビニルプチラール樹脂、セル ロースアセテート樹脂、セルロースアセテートブチレー ト樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂は特に好 ましく用いられる。

【0029】また、親水性樹脂としては、例えばアクリ ル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、塩化ビ ニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ゴム系樹脂(例えばS BR樹脂やNBR樹脂)、酢酸ビニル樹脂、ポリオレフ ィン樹脂、ポリビニルアセタール樹脂などがある。ま た、上記樹脂としては単一の単量体が重合した単一重合 体でもよいし、2種以上の単量体が共重合した共重合体 でもよく、構造が直鎖状のものでも枝分かれしたもので もよい。さらに樹脂同士が架橋されているものでもよ

【0030】この様な樹脂は、市販もされていて以下の ようなものが利用できる。アクリル樹脂としては、例え ば、セピアンA-4635、46583、4601 (以 上ダイセル化学工業(株)製)、Nipol LX81 1、814、820、821、857 (以上日本ゼオン (株) 製) 等。ポリエステル樹脂としては、例えば、F INETEX ES650, 611, 679, 675, 525、801、850(以上大日本インキ化学(株) 製)、WDsize WHS (イーストマンケミカル 製)等。ポリウレタン樹脂としては、例えば、HYDR AN AP10, 20, 30, 40, 101H, HYD RAN HW301、310、350(以上大日本イン キ化学(株)製)など、塩化ビニリデン樹脂としては、 例えば、L502、L513、L123c、L106 c、L111、L114(以上旭化成工業(株)製)な ど、塩化ビニル樹脂としては、例えば、G351、G5 76 (以上日本ゼオン(株)製)など、ポリオレフィン 樹脂としては、例えば、ケミパールS-120、S-3 0.0, SA-1.00, A-1.00, V-1.00, V-200、V-300(以上三井石油化学(株)製)などが ある。本発明におけるバインダーは、これらのポリマー を単独で用いてもよいし、2種類以上プレンドして用い てもよい。

【0031】また、これらの樹脂は、-SO, M、-O SO_3M 、 $-PO(OM_1)$,及 $UOPO(OM_1)$, (但し、Mは水素原子又はNa、K、Li等のアルカ リ金凮原子を表し、Miは水素原子、Na、K、Li等

る少なくとも1種の極性基を有することが好ましく、中 でも-SO,Na, -SO,K, -OSO,Na, -OS O, Kを有することが好ましい。パインダーの分子量 は、質量平均分子量で通常5,000~100,000 であり、好ましくは10,000~50,000であ る。画像記録層に用いられるバインダーは、これらの中 でもアクリル樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ゴム系 樹脂、ポリウレタン、ポリエステルが好ましく、スチレ ンープタジエン樹脂、ポリウレタン、ポリエステルがよ り好ましい。画像記録保護層やバックコート層に用いら 10 れるバインダーは、これらの中でもセルロース樹脂、ア クリル樹脂、ポリウレタン、ポリエステルが好ましい。 【0032】本発明において、有機銀塩は還元可能な銀 源であり、還元可能な銀イオン源を含有する有機酸及び ヘテロ有機酸の銀塩、特に長鎖(10~30、好ましく は15~25の炭素原子数)の脂肪族カルボン酸及び含 窒素複素環が好ましい。配位子が、4.0~10.0の 銀イオンに対する総安定定数を有する有機又は無機の銀 塩錯体も有用である。好適な銀塩の例は、Resear ch Disclosure (以降、単にRDと略す) 第17029及び29963に記載されており、次のも のがある:有機酸の塩(例えば、没食子酸、シュウ酸、 ベヘン酸、ステアリン酸、パルミチン酸、ラウリン酸等 の塩) ;銀のカルボキシアルキルチオ尿素塩(例えば、 1- (3-カルボキシプロピル)チオ尿素、1-(3-カルボキシプロピル)-3,3-ジメチルチオ尿素 等);アルデヒドとヒドロキシ置換芳香族カルボン酸 (例えば、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プチ ルアルデヒドのようなアルデヒド類とサリチル酸、ベン ジル酸 3, 5 - ジヒドロキシ安息香酸、5, 5 - チオジ 30 サリチル酸のようなヒドロキシ置換酸類)とのポリマー 反応生成物の銀錯体;チオン類の銀塩又は錯体(例え ば、3-(2-カルボキシエチル)-4-ヒドロキシメ チルー4-チアゾリン-2-チオン及び3-カルボキシ メチルー4ーメチルー4ーチアゾリンー2ーチオン); イミダゾール、ピラゾール、ウラゾール、1,2,4-チアゾール及び1H-テトラゾール、3-アミノ-5-ベンジルチオー1、2、4-トリアゾール及びベンゾト リアゾールから選択される窒素酸と銀との錯体または 塩;サッカリン、5-クロロサリチルアルドキシム等の 40 銀塩;メルカプチド類の銀塩等が挙げられる。好ましい 銀源はベヘン酸銀、アラキジン酸銀および/またはステ アリン酸銀である。

【0033】有機銀塩化合物は、水溶性銀化合物と銀と錯形成する化合物を混合することにより得られるが、正混合法、逆混合法、同時混合法、特開平9-127643号に記載されている様なコントロールドダブルジェット法等が好ましく用いられる。例えば、有機酸にアルカリ金属塩(例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど)を加えて有機酸アルカリ金属塩ソープ(例えば、

ベヘン酸ナトリウム、アラキジン酸ナトリウムなど)を 作製した後に、コントロールドダブルジェット法によ り、前記ソープと硝酸銀などを添加して有機銀塩の結晶 を作製する。その際にハロゲン化銀粒子を混在させても よい。

【0034】本発明におけるハロゲン化銀粒子は、光セ ンサーとして機能するものである。本発明においては、 画像形成後の白濁を低く抑えるため、及び良好な画質を 得るために平均粒子サイズは小さい方が好ましく、平均 粒子サイズが 0.1μ m以下、より好ましくは0.01 $\sim 0.1 \mu$ m、特に $0.02 \sim 0.08 \mu$ mが好まし い。ここでいう粒子サイズとは、ハロゲン化銀粒子が立 方体或いは八面体のいわゆる正常晶である場合には、ハ ロゲン化銀粒子の稜の長さをいう。又、正常晶でない場 合、例えば、球状、棒状、或いは平板状の粒子の場合に は、ハロゲン化銀粒子の体積と同等な球を考えたときの 直径をいう。またハロゲン化銀粒子は単分散であること が好ましい。ここでいう単分散とは、下記式で求められ る単分散度が40%以下をいう。更に好ましくは30% 以下であり、特に好ましくは0.1~20%となる粒子 である。

【0035】単分散度= (粒径の標準偏差) / (粒径の 平均値) × 100

本発明においては、ハロゲン化銀粒子が平均粒径0.1 μ m以下で、かつ単分散粒子であることがより好ましく、この範囲にすることで画像の粒状性も向上する。

【0036】ハロゲン化銀粒子の形状については、特に制限はないが、ミラー指数 [100] 面の占める割合が高いことが好ましく、この割合が50%以上、更には70%以上、特に80%以上であることが好ましい。ミラー指数 [100] 面の比率は、増感色素の吸着における[111] 面と [100] 面との吸着依存性を利用したT. Tani; J. Imaging Sci., 29, 165 (1985) により求めることができる。

【0037】また、もう一つの好ましいハロゲン化銀粒子の形状は、平板粒子である。ここでいう平板粒子とは、投影面積の平方根を粒径 r μ mとして、垂直方向の厚みを h μ mとした場合のアスペクト比=r/hが3以上のものをいう。その中でも好ましくは、アスペクト比が3以上、50以下である。また粒径は0.1 μ m以下であることが好ましく、さらに $0.01\sim0.08$ μ mが好ましい。これらは米国特許第5,264,337号、同5,314,798号、同5,320,958号等に記載されており、容易に目的の平板状粒子を得ることができる。本発明においてこれらの平板状粒子を用いた場合、さらに画像の鲜鋭性も向上する。

【0038】ハロゲン組成としては特に制限はなく、塩化銀、塩臭化銀、塩沃臭化銀、臭化銀、沃臭化銀、沃化銀のいずれであってもよい。本発明に用いられる写真乳剤は、P. Glafkides著Chimie et

50

Q

Physique Photographique (Paul Montel社刊、1967年)、G.F.D uffin著 Photographic Emulsion Chemistry (The Focal Press刊、1966年)、V.L.Zelikmanet al著Making and Coating Photographic Emulsion (The Focal Press刊、1964年)等に記載された方法を用いて調製することができる。

【0039】本発明に用いられるハロゲン化銀には、照 10 度不軌改良や感度調整のために、元素周期律表の6族から10族に属する金属のイオン又は錯体イオンを含有することが好ましい。上記の金属としては、W、Fe、Co、Ni、Cu、Ru、Rh、Pd、Re、Os、Ir、Pt、Auが好ましい。

【0040】ハロゲン化銀粒子は、ヌードル法、フロキュレーション法等、当業界で知られている方法の水洗により脱塩することができるが、本発明においては脱塩してもしなくてもよい。

【0041】本発明におけるハロゲン化銀粒子は、化学 増感されていることが好ましい。好ましい化学増感法としては、当業界でよく知られているように硫黄増感法、セレン増感法、テルル増感法、金化合物や白金、パラジウム、イリジウム化合物等の貴金属増感法や還元増感法を適宜選択して用いることができる。

【0042】本発明においては、感光材料の失透を防ぐためには、ハロゲン化銀粒子及び有機銀塩の総量は、銀量に換算して $1m^{2}$ 当たり $0.3\sim2.2g$ であり、

0.5 g \sim 1.5 g がより好ましい。この範囲にすることで硬調な画像が得られる。また、銀総量に対するハロゲン化銀の量は、質量比で50%以下、好ましくは25%以下、更に好ましくは0.1 \sim 15%の間である。

【0043】本発明に使用する分光増感色素は、必要に より、例えば、特開昭63-159841号、同60-140335号、同63-231437号、同63-2 59651号、同63-304242号、同63-15 245号等の各公報、米国特許第4,639,414 号、同第4,740,455号、同第4,741,96 6号、同第4, 751, 175号、同第4, 835, 0 96号等の各明細書に記載された各増感色素を使用する 40 ことができる。本発明に使用される有用な増感色素は、 例えば、RD Item第17643IV-A項(197 8年12月p. 23)、同Item1831X項(19 78年8月p. 437) に記載もしくは引用された文献 に記載されている。特に、各種スキャナー光源の分光特 性に適合した分光感度を有する増感色素を、有利に選択 することができ、例えば、特開平9-34078号、同 9-54409号、同9-80679号記載の増感色素 が好ましく用いられる。

【0044】本発明の熱現像感光材料は硬調化剤を含有 50

し、硬調化剤として下記一般式(H)で表されるヒドラジン誘導体、一般式(G)で表される化合物、一般式(P)で表される4級オニウム化合物、一般式(A)~

10

(D)で表される化合物及びヒドロキシアミン、アルカノールアミン、フタル酸アンモニウム化合物が挙げられ、まず、下記一般式(H)で表されるヒドラジン誘導体化合物について説明する。

[0045]

【化1】

一般式(H)

A1 A2 A0-N-N-B0

【0046】式中、A。はそれぞれ置換基を有してもよ い脂肪族基、芳香族基、複素環基又は-G。-D。基を、 B。はブロッキング基を表し、A、A、はともに水素原 子、又は一方が水素原子で他方はアシル基、スルホニル 基又はオキザリル基を表す。ここで、G。は-CO-基、-COCO-基、-CS-基、-C(=NG,D,) -基、-SO-基、-SO,-基又は-P(O)(G,D ,) -基を表し、G, は単なる結合手、-〇-基、-S-基又は-N(D₁)-基を表し、D₁は脂肪族基、芳香族 基、複素環基又は水素原子を表し、分子内に複数のD、 が存在する場合、それらは同じであっても異なってもよ い。D。は水素原子、脂肪族基、芳香族基、複素環基、 アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキル チオ基、アリールチオ基を表す。好ましいD₀としては 水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基等が挙 げられる。

【0047】一般式(H)において、A。で表される脂肪族基は好ましくは炭素数1~30のものであり、特に炭素数1~20の直鎖、分岐又は環状のアルキル基が好ましく、例えばメチル基、エチル基、tーブチル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基が挙げられ、これらは更に適当な置換基(例えば、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルホキシ基、スルホンアミド基、スルファモイル基、アシルアミノ基、ウレイド基等)で置換されていてもよい。

【0048】一般式(H)において、A。で表される芳香族基は、単環又は縮合環のアリール基が好ましく、例えばベンゼン環又はナフタレン環が挙げられ、A。で表される複素環基としては、単環又は縮合環で窒素、硫黄、酸素原子から選ばれる少なくとも一つのヘテロ原子を含む複素環が好ましく、例えばピロリジン環、イミダゾール環、テトラヒドロフラン環、モルホリン環、ピリジン環、ピリミジン環、キノリン環、チアゾール環、ベンゾチアゾール環、チオフェン環、フラン環が挙げられる。A。の芳香族基、複素環基及び一G。一D。基は置換基を有していてもよい。A。として、特に好ましいものはアリール基及び一G。一D。基である。

【0049】又、一般式[H]において、A。は耐拡散

基又はハロゲン化銀吸着基を少なくとも一つ含むことが 好ましい。耐拡散基としては、カプラー等の不動性写真 用添加剤にて常用されるバラスト基が好ましく、バラス ト基としては、写真的に不活性であるアルキル基、アル ケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、フェニル基、 プェノキシ基、アルキルフェノキシ基等が挙げられ、置 換基部分の炭素数の合計は8以上であることが好まし 67.

【0050】一般式(H)において、ハロゲン化銀吸着 促進基としては、チオ尿素、チオウレタン基、メルカプ 10 ト基、チオエーテル基、チオン基、複素環基、チオアミ ド複素環基、メルカプト複素環基或いは特開昭64-9 0439号に記載の吸着基等が挙げられる。

【0051】一般式(H)において、B。はブロッキン グ基を表し、好ましくは-G。-D。基であり、G。は-CO-基、-COCO-基、-CS-基、-C(=NG ₁D₁) -基、-SO-基、-SO₂-基又は-P(O) (G, D,) -基を表す。好ましいG。としては-CO-基、-COCO-基が挙げられ、G」は単なる結合手、 -O-基、-S-基又は-N(D₁)-基を表し、D₁は 20 脂肪族基、芳香族基、複素環基又は水素原子を表し、分 子内に複数のD」が存在する場合、それらは同じであっ ても異なってもよい。D。は水素原子、脂肪族基、芳香 族基、複素環基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオ キシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基を表し、好ま しいD。としては水素原子、アルキル基、アルコキシ 基、アミノ基等が挙げられる。A,、A,はともに水素原 子、又は一方が水素原子で他方はアシル基(アセチル 基、トリフルオロアセチル基、ベンゾイル基等)、スル 等)、又はオキザリル基(エトキザリル基等)を表す。 【0052】更に好ましいヒドラジン誘導体は、下記一 般式 (H-1)、(H-2)、(H-3)、(H-4) で表される。

[0053] 【化2】

一般式(H-1)

一般式(H-2)

一般式(H-3)

$$R_{31}-G_{31}-N-N-G_{32}-R_{32}$$
 A_1
 A_2

一般式(H-4)

【0054】一般式 (H-1) において、R₁₁、R₁₂及 びRいはそれぞれ独立に置換もしくは無置換のアリール 基またはヘテロアリール基を表すが、アリール基として 具体的には、例えばフェニル、p-トリル、ナフチルな どが挙げられる。ヘテロアリール基として具体的には、 例えばトリアゾール残基、イミダゾール残基、ピリジン 残基、フラン残基、チオフェン残基などがあげられる。 また、R₁₁、R₁₂及びR₁₃はそれぞれ任意の連結基を介 して結合しても良い。R₁₁、R₁,及びR₁,が置換基を有 ホニル基(メタンスルホニル基、トルエンスルホニル基 30 する場合、その置換基としては例えばアルキル基、アル ケニル基、アルキニル基、アリール基、複素環基、4級 化された窒素原子を含むヘテロ環基(例えばピリジニオ 基)、ヒドロキシ基、アルコキシ基(エチレンオキシ基 もしくはプロピレンオキシ基単位を繰り返し含む基を含 む)、アリールオキシ基、アシルオキシ基、アシル基、 アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル 基、カルバモイル基、ウレタン基、カルボキシル基、イ ミド基、アミノ基、カルボンアミド基、スルホンアミド 基、ウレイド基、チオウレイド基、スルファモイルアミ 40 ノ基、セミカルバジド基、チオセミカルバジド基、ヒド ラジノ基、4級のアンモニオ基、(アルキル、アリー ル、またはヘテロ環)チオ基、メルカプト基、(アルキ ルまたはアリール)スルホニル基、(アルキルまたはア リール)スルフィニル基、スルホ基、スルファモイル 基、アシルスルファモイル基、(アルキルもしくはアリ ール)スルホニルウレイド基、(アルキルもしくはアリ ール)スルホニルカルバモイル基、ハロゲン原子、シア ノ基、ニトロ基、リン酸アミド基などが挙げられる。R ,,、R,,及びR,,として好ましくはいずれもが置換もし 50 くは無置換のフェニル基であり、より好ましくはR...、

R.,及びR.,のいずれもが無置換のフェニル基である。 【0055】 R.、はヘテロアリールオキシ基、ヘテロア リールチオ基を表すが、ヘテロアリールオキシ基として 具体的には、ピリジルオキシ基、ピリミジルオキシ基、 インドリルオキシ基、ベンゾチアゾリルオキシ基、ベン ズイミダゾリルオキシ基、フリルオキシ基、チエニルオ キシ基、ピラゾリルオキシ基、イミダゾリルオキシ基等 が挙げられる。ヘテロアリールチオ基として具体的には ピリジルチオ基、ピリミジルチオ基、インドリルチオ 基、ベンゾチアゾリルチオ基、ベンズイミダゾリルチオ 10 は互いにスルホニル基である。 基、フリルチオ基、チエニルチオ基、ピラゾリルチオ 基、イミダゾリルチオ基等が挙げられる。R., として好 ましくはピリジルオキシ基、チエニルオキシ基である。 【0056】A,、A,は、一般式(H)で記載した A,、A,と同義である。好ましくはA,、A,ともに水素 原子の場合である。

【0057】一般式(H-2)において、R, は置換も しくは無置換のアルキル基、アリール基またはヘテロア リール基を表すが、アルキル基として具体的には、メチ ル基、エチル基、 t ープチル基、2-オクチル基、シク ロヘキシル基、ベンジル基、ジフェニルメチル基等が挙 げられる。アリール基及びヘテロアリール基として具体 的には、R₁₁、R₁,及びR₁,と同様のものが挙げられ る。また、R21が置換基を有する場合の置換基の具体的 な例としては、R.,、R.,及びR.,の置換基と同様のも のが挙げられる。R、として好ましくはアリール基また はヘテロアリール基であり、特に好ましくは置換もしく は無置換のフェニル基である。

【0058】R,,は水素、アルキルアミノ基、アリール アミノ基、ヘテロアリールアミノ基を表すが、アルキル 30 アミノ基として具体的には、メチルアミノ基、エチルア ミノ基、プロピルアミノ基、プチルアミノ基、ジメチル アミノ基、ジエチルアミノ基、エチルメチルアミノ基等 が挙げられる。アリールアミノ基としてはアニリノ基、 ヘテロアリール基としてはチアゾリルアミノ基、ベンズ イミダゾリルアミノ基、ベンズチアゾリルアミノ基等が 挙げられる。R,,として好ましくはジメチルアミノ基ま たはジエチルアミノ基である。

【0059】A₁、A₂は、一般式(H-1)で記載した A_1 、 A_2 と同義である。一般式 (H-3) において、R-4031、R3,は各々一価の置換基を表すが、一価の置換基と しては、水素原子、R₁₁、R₁,及びR₁,の置換基として 挙げられた基が挙げられるが、好ましくは、水素原子、 アルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、アルコキ シ基、アミノ基が挙げられる。更に好ましくはアリール 基またはアルコキシ基である。特に好ましいのは、R,, とR₃,の少なくとも一つがtertープトキシ基である ものであり、別の好ましい構造は、R、がフェニル基の とき、R₃,がtert-ブトキシ基である。

[0060] G₃₁、G₃₂は、各々一(CO) p-基、- 50

C (=S) -、スルホニル基、スルホキシ基、-P (= O) R,, - 基又はイミノメチレン基を表し、pは1又は 2の整数を表し、R,,はアルキル基、アルケニル基、ア ルキニル基、アリール基、アルコキシ基、アルケニルオ キシ基、アルキニルオキシ基、アリールオキシ基、アミ ノ基を表す。但し、G,,がスルホニル基のとき、G,,は カルボニル基ではない。 G,1、G,1として好ましくは、 各々-CO-基、-COCO-基、スルホニル基または - CS-であり、より好ましくは互いに-CO-基また

【0061】A₁、A₂は一般式(H-1)で記載したA 1、A,と同義である。一般式(H-4)において、 R.,、R.,およびR.,は一般式(H-1)における R₁₁、R₁,およびR₁,と同義である。R₁₁、R₄,および R.,として好ましくはいずれもが置換もしくは無置換の フェニル基であり、より好ましくはR.1、R.2及びR.3 のいずれもが無置換のフェニル基である。R.,、R 45は、各々無置換または置換アルキル基を表すが、具体 的な例としては、メチル基、エチル基、tープチル基、 2-オクチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、ジフ エニルメチル基等が挙げられる。R.,、R.,として好ま しくは互いにエチル基である。

【0062】A₁、A₂は一般式(H-1)で記載したA 」、A,と同義である。以下、一般式(H − 1)~(H − 4) で表される化合物の具体例を挙げるが本発明はこれ らに限定されるものではない。

[0063] 【化3】

H-1-1

H-1-2

H-1-3

H-1-4

[0064] 【化4】 H-1-5

H-1-6

H - 1 - 7

H-1-8

[0065] 【化5】

[0066] 【化6】

19 H-2-1

H-2-3

H-2-5

H-2-9

[0067] 【化7】

$$H - 3 - 3$$

$$F_3C$$
 SO_2 N SO_2 CF_3

H-3-6

[0068]

【化8】

$$H-3-10$$
 $C_{12}H_{25}-C-N-N-C-OC_4H_9(t)$

$$\begin{array}{c|c} H-3-11 & & & & \\ & & & S_2-N-N-C-OC_4H_0(t) \\ & & & H \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} H-3-12 & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ & \bigcirc & \square & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ & \square & -N-N-C-OC_4H_{\theta}(t) & \\ & H & H & \end{array}$$

[0069]

【化9】

H - 4 - 3

$$H - 4 - 4$$

40

H-4-5

【0070】上記の一般式 (H-1)~ (H-4)で表 される化合物は、公知の方法により容易に合成すること ができ、例えば米国特許第5,464,738号明細書 又は同第5,496,695号明細書を参考にして合成 することができる。

【0071】その他に好ましく用いることのできるヒド ラジン誘導体は、米国特許第5,545,505号明細 書、カラム11~20に記載の化合物H-1~H-2 9、米国特許第5、464、738号明細書、カラム9 ~11に記載の化合物1~12である。これらのヒドラ ジン誘導体は、公知の方法で合成することができる。

【0072】次に下記一般式(G)で表される化合物に ついて説明する。

[0073] 【化10】

【0074】一般式(G)において、XとRはシスの形 で表示されているが、XとRがトランス型の場合も本発 明に含まれる。

【0075】一般式(G)において、Xは電子吸引性基 を表す。電子吸引性基とは、置換基定数σpが正の値を 30 とりうる置換基のことである。具体的には、置換アルキ ル基(ハロゲン置換アルキル等)、置換アルケニル基 (シアノビニル等)、置換・未置換のアルキニル基(ト リフルオロメチルアセチレニル、シアノアセチレニル 等)、置換アリール基(シアノフェニル等)、置換・未 置換のヘテロ環基(ピリジル、トリアジニル、ベンゾオ キサゾリル等)、ハロゲン原子、シアノ基、アシル基 (アセチル、トリフルオロアセチル、ホルミル等)、チ オアセチル基(チオアセチル、チオホルミル等)、オキ サリル基(メチルオキサリル等)、オキシオキサリル基 (エトキサリル等)、チオオキサリル基(エチルチオオ キサリル等)、オキサモイル基(メチルオキサモイル 等)、オキシカルボニル基(エトキシカルボニル等)、 カルボキシル基、チオカルボニル基(エチルチオカルボ ニル等)、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スル ホニル基、スルフィニル基、オキシスルホニル基(エト キシスルホニル等)、チオスルホニル基(エチルチオス ルホニル等)、スルファモイル基、オキシスルフィニル 基(メトキシスルフィニル等)、チオスルフィニル基 (メチルチオスルフィニル等)、スルフィナモイル基、 50 スフィナモイル基、ホスホリル基、ニトロ基、イミノ

基、N-カルボニルイミノ基(N-アセチルイミノ等)、N-スルホニルイミノ基(N-メタンスルホニルイミノ等)、ジシアノエチレン基、アンモニウム基、スルホニウム基、ホスホニウム基、ピリリウム基、インモニウム基が挙げられるが、アンモニウム基等が環を形成したヘテロ環状のものも含まれる。σρ値として0.30以上の置換基が特に好ましい。

【0076】Wは、水素原子、アルキル基、アルケニル 基、アルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、ハロゲン 10 原子、アシル基、チオアシル基、オキサリル基、オキシ オキサリル基、チオオキサリル基、オキサモイル基、オ キシカルボニル基、チオカルボニル基、カルバモイル 基、チオカルバモイル基、スルホニル基、スルフィニル 基、オキシスルホニル基、チオスルホニル基、スルファ モイル基、オキシスルフィニル基、チオスルフィニル 基、スルフィナモイル基、ホスホリル基、ニトロ基、イ ミノ基、N-カルボニルイミノ基、N-スルホニルイミ ノ基、ジシアノエチレン基、アンモニウム基、スルホニ ウム基、ホスホニウム基、ピリリウム基、インモニウム 20 基を表す。Wとして表されるアルキル基としては、メチ ル、エチル、トリフルオロメチル等が、アルケニル基と してはビニル、ハロゲン置換ビニル、シアノビニル等 が、アルキニル基としてはアセチレニル、シアノアセチ レニル等が、アリール基としてはニトロフェニル、シア ノフェニル、ペンタフルオロフェニル等が、ヘテロ環基 としてはピリジル、ピリミジル、トリアジニル、スクシ ンイミド、テトラゾリル、トリアゾリル、イミダゾリ ル、ベンソオキサゾリル等が挙げられる。Wとしては σ p値が正の電子吸引性基が好ましく、更にはその値が 0. 30以上のものが好ましい。

【0077】Rはハロゲン原子、ヒドロキシ基、アルコ キシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルケ ニルオキシ基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル オキシ基、アミノカルボニルオキシ基、メルカプト基、 アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、ア ルケニルチオ基、アシルチオ基、アルコキシカルボニル チオ基、アミノカルボニルチオ基、ヒドロキシ基又はメ ルカプト基の有機又は無機の塩(例えば、ナトリウム 塩、カリウム塩、銀塩等)、アミノ基、アルキルアミノ 40 基、環状アミノ基(例えば、ピロリジノ基)、アシルア ミノ基、オキシカルボニルアミノ基、ヘテロ環基(5~ 6 員の含窒素ヘテロ環、例えばベンツトリアゾリル基、 イミダゾリル基、トリアゾリル基、テトラゾリル基 等)、ウレイド基、スルホンアミド基を表す。XとW、 XとRはそれぞれ互いに結合して環状構造を形成しても よい。XとWが形成する環としては、例えばピラゾロ ン、ピラゾリジノン、シクロペンタンジオン、β-ケト ラクトン、β-ケトラクタム等が挙げられる。Rの置換 基の内、好ましくはヒドロキシ基、メルカプト基、アル 50

コキシ基、アルキルチオ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ 基又はメルカプト基の有機又は無機の塩、ヘテロ環基が 挙げられ、更に好ましくはヒドロキシ基、アルコキシ 基、ヒドロキシ基又はメルカプト基の有機又は無機の 塩、ヘテロ環基が挙げられ、特に好ましくはヒドロキシ 基、ヒドロキシ基又はメルカプト基の有機又は無機の塩 が挙げられる。

【0078】また上記X及びWの置換基の内、置換基中にチオエーテル結合を有するものが好ましい。

[0079]次に下記一般式(P)で表される化合物について説明する。

[0080]

【化11】

一般式(P)

$$R_2 \xrightarrow{R_1} Q \xrightarrow{R_4} R_3 X$$

【0081】一般式 (P) において、Qは窒素原子又は 燐原子を表し、 R_1 、 R_2 、 R_3 及び R_4 は各々、水素原子 又は置換基を表し、 X^- はアニオンを表す。尚、 $R_1 \sim R_4$ 、は互いに連結して環を形成してもよい。

【0082】R、~R、で表される置換基としては、アルキル基(メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基等)、アルケニル基(アリル基、ブテニル基等)、アルキニル基(プロパルギル基、ブチニル基等)、アリール基(フェニル基、ナフチル基等)、複素環基(ピペリジニル基、ピペラジニル30 基、モルホリニル基、ピリジル基、フリル基、チエニル基、テトラヒドロフリル基、テトラヒドロチエニル基、スルホラニル基等)、アミノ基等が挙げられる。

【0083】R₁~R₄が互いに連結して形成しうる環としては、ピペリジン環、モルホリン環、ピペラジン環、キヌクリジン環、ピリジン環、ピロール環、イミダゾール環、トリアゾール環、テトラゾール環等が挙げられる。

【0084】R、~R、で表される基は、各々ヒドロキシル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、カルボキシル基、スルホ基、アルキル基、アリール基等の置換基を有してもよい。R、R、R、R、R、及びR、としては、各々水素原子及びアルキル基が好ましい。

【0085】X⁻が表すアニオンとしては、ハロゲンイオン、硫酸イオン、硝酸イオン、酢酸イオン、p-トルエンスルホン酸イオン等の無機及び有機のアニオンが挙げられる。

【0086】更に好ましくは下記一般式(Pa)、(Pb)又は(Pc)で表される化合物、及び下記一般式 [T]で表される化合物が用いられる。

[0087]

【化12】 一般式(Pa)

一般式(Pb)

$$\begin{bmatrix} A^3 & A^4 \\ A^3 & A^4 \end{bmatrix} n_p(X_p^-)$$

一般式(Pc)

【0088】式中、A'、A'、A'、A'及びA'は、各 々含窒素複素環を完成させるための非金属原子群を表 し、酸素原子、窒素原子、硫黄原子を含んでもよく、ベ ンゼン環が縮合しても構わない。A'、A'、A'、A'及 びA⁵で構成される複素環は、各々置換基を有してもよ く、それぞれ同一でも異なっていてもよい。置換基とし ては、アルキル基、アリール基、アラルキル基、アルケ ニル基、アルキニル基、ハロゲン原子、アシル基、アル 30 コキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、ス ルホ基、カルボキシ基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、 アリールオキシ基、アミド基、スルファモイル基、カル バモイル基、ウレイド基、アミノ基、スルホンアミド 基、スルホニル基、シアノ基、ニトロ基、メルカプト 基、アルキルチオ基、アリールチオ基を表す。 A¹、 A'、A'、A'及びA'の好ましい例としては、5~6員 環(ピリジン、イミダゾール、チオゾール、オキサゾー ル、ピラジン、ピリミジン等の各環)を挙げることがで き、更に好ましい例として、ピリジン環が挙げられる。 【0089】B,は2価の連結基を表し、mは0又は1 を表す。2価の連結基としては、アルキレン基、アリー レン基、アルケニレン基、-SO₂-、-SO-、-O -、-S-、-CO-、-N(R⁶)-(R⁶はアルキル 基、アリール基、水素原子を表す)を単独又は組み合わ せて構成されるものを表す。B。として好ましくは、ア ルキレン基、アルケニレン基を挙げることができる。 【0090】R'、R'及びR'は、各々炭素数1~20

のアルキル基を表す。又、R'及びR'は同一でも異って いてもよい。アルキル基とは、置換或いは無置換のアル 50

キル基を表し、置換基としては、A'、A'、A'、A'入 びA'の置換基として挙げた置換基と同様である。

28

【0091】R'、R'及びR'の好ましい例としては、 それぞれ炭素数4~10のアルキル基である。更に好ま しい例としては、置換或いは無置換のアリール置換アル キル基が挙げられる。

【0092】X。」は分子全体の電荷を均衡させるのに必 要な対イオンを表し、例えば塩素イオン、臭素イオン、 沃素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、p-トルエンス 10 ルホナート、オキザラート等を表す。 n。は分子全体の 電荷を均衡さすに必要な対イオンの数を表し、分子内塩 の場合にはn,は0である。

[0093]

【化13】

一般式 [T]

40

$$\begin{bmatrix} R_6 & & & \\ & & &$$

【0094】上記一般式〔T〕で表されるトリフェニル テトラゾリウム化合物のフェニル基の置換基R。、R。、 R,は、各々水素原子もしくは電子吸引性度を示すハメ ットのシグマ値(σρ)が負のものが好ましい。

【0095】フェニル基におけるハメットのシグマ値は 多くの文献、例えばジャーナル・オブ・メディカルケミ ストリー (Journal of Medical C hemistry) 20巻、304頁、1977年に記 載のC. ハンシュ (C. Hansch) 等の報文等に見 ることが出来、特に好ましい負のシグマ値を有する基と しては、例えばメチル基 (σρ=-0.17以下何れも σ p値)、エチル基(-0.15)、シクロプロピル基 (-0.21)、n-プロピル基(-0.13)、is o-プロピル基(-0.15)、シクロブチル基(-0. 15)、n-ブチル基(-0. 16)、iso-ブ チル基 (-0.20)、n-ペンチル基 (-0.1 5)、シクロヘキシル基(-0.22)、アミノ基(-0.66)、アセチルアミノ基(-0.15)、ヒドロ キシ基 (-0.37)、メトキシ基 (-0.27)、エ トキシ基 (-0.24)、プロポキシ基 (-0.2 5)、ブトキシ基(-0.32)、ペントキシ基(-0.34) 等が挙げられ、これらは何れも一般式〔T〕 の化合物の置換基として有用である。

【0096】nは1或いは2を表し、X₇" で表される アニオンとしては、例えば塩化物イオン、臭化物イオ ン、ヨウ化物イオン等のハロゲンイオン、硝酸、硫酸、 過塩素酸等の無機酸の酸根、スルホン酸、カルボン酸等 の有機酸の酸根、アニオン系の活性剤、具体的にはp-

トルエンスルホン酸アニオン等の低級アルキルベンゼン スルホン酸アニオン、p-ドデシルベンゼンスルホン酸 アニオン等の髙級アルキルベンゼンスルホン酸アニオ ン、ラウリルスルフェートアニオン等の高級アルキル硫 酸エステルアニオン、テトラフェニルポロン等の硼酸系 アニオン、ジー2-エチルヘキシルスルホサクシネート アニオン等のジアルキルスルホサクシネートアニオン、 セチルポリエテノキシサルフェートアニオン等の高級脂 肪酸アニオン、ポリアクリル酸アニオン等のポリマーに 酸根のついたもの等を挙げることができる。

【0097】上記4級オニウム化合物は公知の方法に従 って容易に合成でき、例えば上記テトラゾリウム化合物 はChemical Reviews vol. 55 p. 335~483に記載の方法を参考にできる。

【0098】次に下記一般式(A)~(D)で表される 化合物やヒドロキシルアミン、アルカノールアミン、フ タル酸アンモニウムも挙げられる。

[0099]

【化14】

一般式(A)

一般式(B)

一般式(C)

一般式(D)

【0100】一般式(A)で表される化合物について説 明する。前記一般式(A)において、EWDは電子吸引 性基を表し、R'、R'およびR'はそれぞれ水素原子ま たは1価の置換基を表す。但し、R'およびR'のうちの 少なくとも1つは1価の置換基である。ここにEWDで 表される電気吸引性基とはハメットの置換基定数 σ pが 正の値を取りうる置換基のことであり、具体的には、シ アノ基、アルコキシカルポニル基、アリールオキシカル ポニル基、カルバモイル基、スルファモイル基、アルキ ルスルホニル基、アリールスルホニル基、ニトロ基、ハ 50 基、インドリルオキシ基、ベンゾチアゾリルオキシ基、

ロゲン原子、パーフルオロアルキル基、アシル基、ホル ミル基、ホスホリル基、カルボキシ基(またはその 塩)、スルホ基(またはその塩)、飽和もしくは不飽和 のヘテロ環基、アルケニル基、アルキニル基、アシルオ キシ基、アシルチオ基、スルホニルオキシ基、またはこ れら電子吸引性基で置換されたアリール基等が挙げられ る。これらの基は置換基を有していてもよい。具体的化 合物としては、例えば、米国特許第5,545,515 号に開示された化合物が挙げられる。

【0101】一般式(B)で表される化合物について説 明する。前記一般式(B)において、R⁹は水素原子、 アルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アルキルチ オ、アミド基、アリール基、アラルキル基、アリールオ キシ基、アリールチオ基、アニリノ基、ヘテロ環基、ヘ テロ環オキシ基またはヘテロ環チオ基を表すが、アルキ ル基であるのが好ましく、メチル基、エチル基であるの がより好ましい。

【0102】R'®は水素原子、アルキル基、アルケニル 基、アルコキシ基、アルキルチオ、アミド基、アリール 20 基、アラルキル基、アリールオキシ基、アリールチオ 基、アニリノ基、ヘテロ環基、ヘテロ環オキシ基、ヘテ ロ環チオ基、ヒドラジノ基、アルキルアミノ基、スルホ ニルアミノ基、ウレイド基、オキシカルボニルアミノ 基、アルキニル基または無置換のアミノ基を表すが、ア リール基、ヘテロ環基、ヘテロ環オキシ基、ヘテロ環チ オ基であるのが好ましく、さらに好ましくはヘテロ環オ キシ基、ヘテロ環チオ基である。ヘテロ環オキシ基とし て具体的には、ピリジルオキシ基、ピリミジルオキシ 基、インドリルオキシ基、ベンゾチアゾリルオキシ基、 30 ベンズイミダゾリルオキシ基、フリルオキシ基、チエニ ルオキシ基、ピラゾリルオキシ基、イニダゾリルオキシ 基フリルチオ基、チエニルチオ基、ピラゾリルチオ基、 イニダゾリルチオ基等が挙げられる。R'°として好まし くはピリジルオキシ基、チエニルオキシ基である。

【0103】Xは水素原子、アルキル基、カルバモイル 基またはオキシカルポニル基を表す。Xは水素原子であ るのが好ましい。R'とR'®とが結合して5員から7員 の環を形成してもよい。具体的化合物としては、例え ば、米国特許第5,545,507号に開示された化合 40 物が挙げられる。

【0104】一般式(C)で表される化合物について説 明する。前記一般式(C)において、R'はアルキル 基、アルケニル基、アルコキシ基、アルキルチオ、アミ ド基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、 アリールチオ基、アニリノ基またはヘテロ環基を表すが アリール基、ヘテロ環基、ヘテロ環オキシ基、ヘテロ環 チオ基であるのが好ましい。より好ましくはヘテロ環オ キシ基、ヘテロ環チオ基である。ヘテロ環オキシ基とし て具体的には、ピリジルオキシ基、ピリミジルオキシ

ベンズイミダゾリルオキシ基、フリルオキシ基、チエニルオキシ基、ピラゾリルオキシ基、イニダゾリルオキシ基等が挙げられる。ヘテロ環チオ基として具体的にはピリジルチオ基、ピリミジルチオ基、インドリルチオ基、ベンゾチアゾリルチオ基、ベンズイミダゾリルチオ基、フリルチオ基、チエニルチオ基、ピラゾリルチオ基、イニダゾリルチオ基等が挙げられる。R''として好ましくはピリジルオキシ基、チエニルオキシ基である。具体的化合物としては例えば米国特許第5,558,983号に開示された化合物が挙げられる。

【0105】一般式(D)で表される化合物について説明する。前記一般式(D)において、R¹はベンツヒドロール核、ジフェニルフォスフィン核、トリフェニルメタン核、N, N'ージアルキルピペラジン核、3ーピロロリン核、キサンテン核、9,10ージヒドロアントラ

A1

A3

セン核、9-ヒドロキシフルオレン核、アリルーベーターケトエステル核、アルデヒド核、アルキルーベーターケトエステル核、オキシム核、アミドオキシム核、ベンズアルデヒドオキシム核、アセトフェノンオキシム核、カプロラクタムオキシム核、エチルベンゾイルアセテート核、ピバルデヒド核または、エチルイソブチルアセテート核を表す。具体的化合物としては、例えば、米国特許第5,637,449号に開示された化合物が挙げられる。

10 【0106】以下に本発明の一般式(A)~(D)で表される化合物(硬調化剤)の具体例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0107] 【化15】

A2

KO .

A4

C₂H₅O - C - C - OC₂H₁

A5

A6

Α7

A8

[0108] 【化16】 **B1**

[0109] 【化17】

B2

B3

B4

C1

C3

D1

$$\bigcap_{i=1}^{0} \bigcap_{i=1}^{0} O - C_2H_6$$

【0110】一般式(A)~(D)で表される化合物の 添加量としては、銀1モルあたり1×10-6~1モルで あるのが好ましく、 $1 \times 10^{-1} \sim 5 \times 10^{-1}$ モルである のが特に好ましい。

【0111】本発明の熱現像感光材料には、還元剤を内 蔵させるのが好ましい。好適な還元剤の例は、米国特許 第3,770,448号、同3,773,512号、同 3, 593, 863号、及びResearch Dis closure第17029及び29963に記載され 50 ラゾン類(例えば、アントラセンアルデヒドフェニルヒ

C2

C4

D2

ており、次のものが挙げられる。

【0112】アミノヒドロキシシクロアルケノン化合物 (例えば、2-ヒドロキシ-3-ピペリジノ-2-シク ロヘキセノン) ; 還元剤の前駆体としてアミノレダクト ン類(reductones)エステル(例えば、ピペ リジノヘキソースレダクトンモノアセテート); N-ヒ ドロキシ尿素誘導体(例えば、N-p-メチルフェニル -N-ヒドロキシ尿素);アルデヒド又はケトンのヒド

ドラゾン);ホスファーアミドフェノール類;ホスファ ーアミドアニリン類;ポリヒドロキシベンゼン類(例え ば、ヒドロキノン、t-ブチル-ヒドロキノン、イソプ ロピルヒドロキノン及び(2,5-ジヒドロキシーフェ ニル)メチルスルホン);スルフヒドロキサム酸類(例 えば、ベンゼンスルフヒドロキサム酸);スルホンアミ ドアニリン類 (例えば、4-(N-メタンスルホンアミ ド) アニリン) ; 2-テトラゾリルチオヒドロキノン類 (例えば、2-メチル-5-(1-フェニル-5-テト ラゾリルチオ) ヒドロキノン) ; テトラヒドロキノキサ 10 リン類 (例えば、1, 2, 3, 4-テトラヒドロキノキ サリン);アミドオキシム類;アジン類;脂肪族カルボ ン酸アリールヒドラザイド類とアスコルビン酸の組み合 わせ;ポリヒドロキシベンゼンとヒドロキシルアミンの 組み合わせ;レダクトン及び/又はヒドラジン;ヒドロ キサン酸類; アジン類とスルホンアミドフェノール類の 組み合わせ; α - シアノフェニル酢酸誘導体; ビス - β -ナフトールと1, 3-ジヒドロキシベンゼン誘導体の 組み合わせ;5-ピラゾロン類;スルホンアミドフェノ ール還元剤;2-フェニルインダン-1,3-ジオン 等;クロマン;1,4-ジヒドロピリジン類(例えば、 2, 6-ジメトキシ-3, 5-ジカルポエトキシ-1, 4-ジヒドロピリジン):ピスフェノール類(例えば、 ビス (2-ヒドロキシ-3-t-ブチル-5-メチルフ ェニル) メタン、ピス(6-ヒドロキシーmートリ) メ シトール (mesito1)、2,2-ピス(4-ヒド ロキシー3-メチルフェニル)プロパン、4,4-エチ リデン-ビス (2-t-ブチル-6-メチルフェノー ル))、紫外線感応性アスコルビン酸誘導体;ヒンダー ドフェノール類;3-ピラゾリドン類。中でも特に好ま 30 しい還元剤は、ヒンダードフェノール類である。ヒンダ ードフェノール類としては、下記一般式(A´)で表さ れる化合物が挙げられる。

[0113] 【化18】

一般式(A')

【0114】式中、Rは水素原子、又は炭素原子数1~ 10のアルキル基(例えば、-C, H,、2, 4, 4-ト リメチルペンチル)を表し、R´及びR″は、各々炭素 原子数1~5のアルキル基(例えば、メチル、エチル、 t-ブチル)を表す。

【0115】本発明の熱現像感光材料には、酸化剤を含 有するのが好ましい。本発明に用いられる酸化剤は、保 存時のカブリを低減するものならばどのような酸化剤で あってもよい。このような酸化剤としては、好ましく

は、例えば、特開昭50-119624号、同50-1 20328号、同51-121332号、同54-58 022号、同56-70543号、同56-99335 号、同59-90842号、同61-129642号、 同62-129845号、特開平6-208191号、 同7-5621号、同7-2781号、同8-1580 9号、米国特許第5, 340, 712号、同第5, 36 9,000号、同第5,464,737号、同第3,8 74、946号、同第4,756,999号、同第5, 340、712号、欧州特許第605981A1号、同 622666A1号、同631176A1号、特公昭5 4-165号、特開平7-2781号、米国特許第4, 180,665号および同第4,442,202号に記 載されている化合物等を用いることができるが、好まし くは下記一般式(I)で表されるポリハロゲン化合物で ある。

[0116] 【化19】

20

一般式(I)

 $A-(Y) = \begin{pmatrix} X_1 \\ C - X_3 \end{pmatrix}$

【0117】式中、Aは脂肪族基、芳香族又は複素環基 を表し、 X_1 、 X_2 、 X_3 はそれぞれ水素原子、または電 子吸引基を表し、同一でも異なっていても良い。Yは2 価の連結基を表す。nは0又は1を表す。

【0118】本発明において酸化剤の添加量は、銀1モ ル当たり $1 \times 10^{-1} \sim 1$ モルであるのが好ましく、 $1 \times$ $10^{-3} \sim 0$. 5モルであるのがより好ましい。

【0119】本発明の熱現像感光材料の画像記録層側の 少なくとも1層には、脂肪酸及びその誘導体を含有させ ることが好ましく、その脂肪酸しては、例えば、ラウリ ン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベ ヘン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、エライ ジン酸、また、脂肪酸エステルとしては、例えば、ステ アリン酸ブチル、ステアリン酸アミル、ステアリン酸オ クチル、パルミチン酸ブチル、ミリスチン酸ブチル、ブ トキシエチルステアレート、オレイルオレート、ステア 40 リン酸ブトキシエチルが挙げられる。

【0120】熱現像感光材料の支持体としては、紙、ポ リエチレンを被覆した紙、ポリプロピレンを被覆した 紙、羊皮紙、布、金属(例、アルミニウム、銅、マグネ シウム、亜鉛) のシートまたは薄膜、ガラス、金属 (例、クロム合金、スチール、銀、金、白金) で被覆し たガラスおよびプラスチックフィルムが用いられる。支 持体の用いられるプラスチックの例には、ポリアルキル メタクリレート(例、ポリメチルメタクリレート)、ポ リエステル(例、ポリエチレンテレフタレート)、ポリ 50 ビニルアセタール、ポリアミド(例、ナイロン)および セルロースエステル(例、セルロースニトレート、セル ロースアセテート、セルロース、アセテートプロピオネ ート、セルロースアセテートプチレート)が含まれる。 支持体を、ポリマーで被覆してもよい。ポリマーの例に は、ポリ塩化ビニリデン、アクリル酸系ポリマー(例、 ポリアクリロニトリル、メチルアクリレート)不飽和ジ カルボン酸(例、イタコン酸、アクリル酸)のポリマ ー、カルボキシメチルセルロースおよびポリアクリルア ミドが含まれる。コポリマーを用いてもよい。ポリマー で被覆する代わりに、ポリマーを含む下塗り層を設けて 10 もよい。支持体の寸法特性を向上させるには、支持体を 低張力下でアニール処理を行なうことが有効である。例 えば、特公昭60-22616号、米国特許第2,77 9, 684号、RD第19809、特開平8-2115 47号、同10-10676号、同10-10677 号、同11-47676号、同11-65025号、同 11-138628号、同11-138648号、同1 1-221892号、同11-333922号、同11 -333923号等に記載された公知の方法を適宜組み 合わせることが好ましい。支持体の熱処理時、好ましく 20 は下塗り層塗布時の張力は0.4~80N/cm²、よ り好ましくは $2\sim6~0~\text{N/cm}^{2}$ 、さらに好ましくは 10~50N/cm'である。熱処理温度あるいは乾燥温 度は、70~220℃、より好ましくは80~200℃ であり、さらに好ましくは90~190℃である。熱処 理時間あるいは乾燥時間は、1~30分が好ましく、よ り好ましくは2~20分であり、さらに好ましくは3~ 15分である。

【0121】本発明における層構成の好ましい例として は、支持体の一方の面上に下引き層を設け、その上に画 30 るが、本発明の態様はこれに限定されない。 像記録層を設け、さらにその上に表面保護層を設ける。 下引き層(画像記録層側)は2層以上からなることが好 ましく、下引き層の総乾燥膜厚は、 $0.2\sim5~\mu$ mが好 ましく、 $0.5\sim3\mu m$ であることがより好ましい。画 像記録層の乾燥膜厚は、5~13μmであることが好ま しく、7~11μmであることがより好ましい。表面保 護層の乾燥膜厚は、2~10μmであることが好まし く、4~8μmであることがより好ましい。表面保護層 にはマット剤を含有することが好ましい。マット剤の平 均粒径は $1\sim10\mu$ mが好ましく、 $3\sim7\mu$ mであるこ とがより好ましい。マット剤としては、公知のフィラー が使用できるが、ポリメチルメタクリレート等の有機質 粉末を使用することが好ましい。

【0122】支持体を挟んで画像記録層とは反対側の面 《下引塗布液 a - 1》

バインダー樹脂III (表1に記載) の共重合体ラテックス液(固形分30%)

270g 0.6g (C-1)0.8g ヘキサメチレンー1、6-ビス(エチレンウレア) 0.05g ポリスチレン微粒子 (平均粒径3 μm)

上に下引き層を設け、その上にパックコート層を設け、 さらにその上にバックコート表面保護層を設けることが 好ましい。下引き層(バックコート層側)は2層以上か らなることが好ましく、支持体に最も近い下引き層は、 導電性の金属酸化物及び/または導電性ポリマーを含有 する帯電防止層であることが好ましい。導電性の金属酸 化物としては、Sbで表面処理されたSnО,が、導電 性ポリマーとしてはポリアニリンが好ましい。下引き層 の総乾燥膜厚は、0.2~4μmが好ましく、0.5~ $2\mu m$ であることがより好ましい。バックコート層の乾 燥膜厚は $2\sim10\mu$ mであることが好ましく、 $4\sim8\mu$ mであることがより好ましい。バックコート層にはアン チハレーション染料を含むことが好ましい。バックコー ト表面保護層の乾燥膜厚は、2~10 µmであることが 好ましく、4~8μmであることがより好ましい。バッ クコート表面保護層にはマット剤を含有することが好ま しい。マット剤としては、公知のフィラーが使用できる が、ポリメチルメタクリレート等の有機質粉末を使用す ることが好ましい。マット剤の平均粒径は1~10μm が好ましく、 $3\sim7\mu$ mであることがより好ましい。上 記の層構成、膜厚構成をとることで本発明の効果をより よく発揮することができる本発明の熱現像感光材料を製 造する際の塗布液は、全バインダーの65質量%以上が ポリマーラテックスであることが好ましく、80質量% 以上がポリマーラテックスであることがより好ましい。 また溶媒の45質量%以上が水であることが好ましく、 60質量%以上が水であることがより好ましい。

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明す

[0124] 実施例1

(下引済みPET支持体の作製) 市販の2軸延伸熱固定 済みの厚さ125μmのポリエチレンテレフタレート (以降、PETと略す) フィルムを用い180℃、張力 1. 47×10°Paで1分間の搬送熱処理を行なっ た。このPETフィルムのヤング率はMD方向(長さ方 向) が7. 5×10°Pa、TD方向(幅方向)が7. 4×10'Paであった。この両面に8W/m'・分のコ ロナ放電処理を施し、一方の面に下記下引塗布液 a - 1 を乾燥膜厚0.8μmになるように塗設し乾燥させて下 引層A-1とし、また反対側の面に下引塗布液b-1を 乾燥膜厚0. 8μmになるように塗設し乾燥させて下引 層B-1 (帯電防止層) とした。

40

コロイダルシリカ (平均粒径90μm)

0.1g

水で11に仕上げる

《下引塗布液 b-1》

SnO₂/Sb (9/1 質量比、平均粒径0.18μm)

120g

バインダー樹脂III (表1に記載)の共重合体ラテックス液(固形分30%)

270g

(C-1)

0.6g

(0 1)

ヘキサメチレン-1,6-ビス(エチレンウレア)

0.8g

水で11に仕上げる

引き続き、下引層A-1及び下引層B-1の上表面に、 8W/m¹・分のコロナ放電を施し、下引層A-1の上 には、下記下引上層塗布液 a-2を乾燥膜厚0.9μm になる様に下引層A-2として、下引層B-1の上には 下記下引上層塗布液 b-2 を乾燥膜厚 0 . $2 \mu m$ になる様に帯電防止機能をもつ下引上層 B-2 として塗設した。

《下引上層塗布液 a - 2》

バインダーIII樹脂(表1に記載)の共重合体ラテックス液(固形分30%)

50

(C-1)

0.2g

(C-2)

0.2g

(C - 3)

0. 1 g

シリカ粒子 (平均粒径 3 μm)

2. 0 g

水で11に仕上げる

《下引上層塗布液 b-2》

バインダー樹脂III (表1に記載) の共重合体ラテックス液 (固形分30%)

140g

硫酸アンモニウム

0.5g

(C-4)

1 2 g

ポリエチレングリコール(質量平均分子量600)

6 g

水で11に仕上げる

[0125]

30 【化20】

41 (C-1)
$$C_9H_{19}$$
 C_9H_{19} $O(CH_2CH_2O)_{12}SO_3N_B$

の3種の混合物

【0126】(支持体の熱処理)上記の下引済み支持体 の下引乾燥工程において、支持体を140℃で加熱し、 その後徐々に冷却した。

【0127】(ハロゲン化銀乳剤Aの調製)水900m 1中にイナートゼラチン7.5g及び臭化カリウム10 30 ゲン化銀乳剤Aを1.51g添加し、水酸化ナトリウム mgを溶解して温度35℃、pHを3.0に合わせた 後、硝酸銀74gを含む水溶液370m1と(60/3 8/2)のモル比の塩化ナトリウムと臭化カリウムと沃 化カリウムを硝酸銀に対し等モル、K、〔Ir(NO) Cl₅] 塩を銀1モル当たり1×10⁻⁶モル及び塩化ロ ジウム塩を銀1モル当たり1×10⁻⁶モルを含む水溶液 370mlとを、pAg7.7に保ちながらコントロー ルドダブルジェット法で添加した。その後4-ヒドロキ シー6-メチル-1,3,3a,7-テトラザインデン を添加し、NaOHでpHを8.0、pAgを6.5に 40 ルエチルケトン/トルエン溶液(17質量%)544g 調整することで還元増感を行い平均粒子サイズ0.06 μm、単分散度10%、投影直径面積の変動係数8%、 [100] 面比率87%の立方体沃臭化銀粒子を含む乳 剤を得た。この乳剤にゼラチン凝集剤を用いて凝集沈降 させ脱塩処理を行い、ハロゲン化銀乳剤Aを得た。

【0128】 (ベヘン酸Na溶液の調製) 945mlの 純水にベヘン酸32.4g、アラキジン酸9.9g、ス テアリン酸5.6gを90℃で溶解した。次に髙速で攪 拌しながら1.5モル/Lの水酸化ナトリウム水溶液9 8mlを添加した。次に濃硝酸0.93mlを加えた

後、55℃に冷却して30分攪拌させてベヘン酸Na溶 液を得た。

【0129】(ベヘン酸銀とハロゲン化銀Aのプレフォ ーム乳剤の調製) 上記のベヘン酸Na溶液に、前記ハロ 溶液でpH8. 1に調整した後、1モル/Lの硝酸銀溶 液147m1を7分間かけて加え、さらに20分攪拌し 限外濾過により水溶性塩類を除去した。できたベヘン酸 銀は平均粒子サイズO.8μm、単分散度8%の粒子で あった。分散物のフロックを形成後、水を取り除き、更 に6回の水洗と水の除去を行った後乾燥させてプレフォ ーム乳剤を得た。

【0130】(感光性乳剤の調製)できあがったプレフ オーム乳剤に、バインダー樹脂 I (表1に記載) のメチ とトルエン107gを徐々に添加して混合した後に、 0. 5 mmサイズ 2 r O₁ のピーズミルを用いたメディ ア分散機により、2. 7×10⁷ Paの回転圧で、30 ℃、10分間の分散処理を行い、感光性乳剤を調製し

【0131】前記支持体上に以下の各層を両面同時塗布 し、熱現像感光材料を作製した。尚、乾燥は60℃、1 5分間で行った。

【0132】 (バック面側塗布) 支持体の下引上層B-50 2の上に以下の組成の液を乾燥膜厚が6μmとなるよう

に同時塗布した。

[0133]

バインダー樹脂II(表1に記載) (10%メチルエチルケトン溶液)

15g 0.007g 染料-A 0.007g 染料-B

マット剤:単分散度15%平均粒子サイズ5μm単分散シリカ

0.09g

マット剤:単分散度15%平均粒子サイズ15μm単分散シリカ

0.02g 0.05g C₈ F₁₇ (CH₂ CH₂ O) ₁₂ C₈ F₁₇ 0.01g $C_{5}F_{15}-C_{5}H_{4}-SO_{5}Na$ 0.1g ステアリン酸

[0134] 【化21】 染料-A

H₅C₂OH₂C

【0135】 (バック層表面保護層の塗布) バックコー ト層の上に以下の組成の液を乾燥膜厚が3.5μmとな るように同時塗布した。

[0136]

染料-B

セルロースアセテートプチレート

15g

(10%メチルエチルケトン溶液)

マット剤:単分散度15%平均粒子サイズ5μm単分散シリカ 0.5 g (シリカ全質量の1質量%のアルミニウムで表面処理)

マット剤:単分散度15%平均粒子サイズ15μm単分散シリカ

0.04g

(シリカ全質量の1質量%のアルミニウムで表面処理)

0.05g C₈ F₁₇ (CH₂ CH₂ O) ₁₂ C₈ F₁₇

0.01g $C_9 F_{19} - C_6 H_4 - SO_3 Na$

0.1g ステアリン酸 0. 0μmになる様に塗布した。 (感光層面側塗布) 支持体の下引層A-2の上に以下の

臭化カルシウム (0.1質量%メタノール溶液)

組成の液を塗布銀量が1.0g/m'、乾燥膜厚が1 [0137]

240g 感光性乳剤

1. 7 m l 増感色素A(0.1質量%メタノール溶液)

0.05g 染料-A

ピリジニウムプロミドペルプロミド(6質量%メタノール溶液) 3ml 1. 7 m l

1. 2 m l 酸化剤-1(10質量%メタノール溶液)

2-4-クロロベンゾイル安息香酸(12質量%メタノール溶液)

9. 2 m l

2-メルカプトベンズイミダゾール(1質量%メタノール溶液)11ml 0.1g

化合物A

0.1g 化合物B ポリメチルメタアクリレート (20質量%メチルエチルケトン溶液)

トリプロモメチルスルホキノリン(5質量%メタノール溶液) 17ml

0.4g ヒドラジン誘導体(表1に記載の化合物)

0.3g 硬調化剤 (表1に記載の化合物)

0.6g フタラジン

0.25g 4-メチルフタル酸

0.2g テトラクロロフタル酸

マット剤:単分散度15%平均粒子サイズ5μm単分散シリカ

0.3g (シリカ全質量の1質量%のアルミニウムで表面処理)

20.5ml 還元剤-1(20質量%メタノール溶液)

イソシアネート化合物 0.5g

(モーベイ社製、Desmodur N3300)

0.5g ステアリン酸

ステアリン酸プチル 0.5g

0.5g α -アルミナ (モース硬度9)

增感色素A

[0138] 【化22】

酸化剤-1

[0139]	(表面保護層)	以下の組成の液を感光層の	[0140]
上に乾燥膜厚	が6μmとなる	るよう同時途布した。	

アセトン		5 g
メチルエチルケトン	2	21 g
セルロースアセテートプチレート	2.	3 g
メタノール		7 g
フタラジン	0. 2	25 g
還元剤-1(20質量%メタノール溶液)	1 (m l
. マット剤:単分散度15%平均粒子サイズ5μm単分散シリ	カ	
(シリカ全質量の1質量%のアルミニウムで表面処理)	0.	5 g
マット剤:単分散度15%平均粒子サイズ20μm単分散シ	リカ	
(シリカ全質量の1質量%のアルミニウムで表面処理)	0. 0) 4 g
$CH_1 = CHSO_1CH_1CH_2OCH_1CH_2SO_1CH=CH_1$		
	0.03	35 g
フッ素系界面活性剤:C ₁ , F ₁ , (CH, CH, O) ₁₀ C ₁₁ F ₁₅	0.0) 1 g
$C_8 F_{11} - C_6 H_4 - S O_3 N a$	0. () 1 g
ステアリン酸	0.	1 g

塗膜形成した後の試料を用い、バインダーを除去した後 20 の包装材料で巻いた。 に、レプリカ法で電子顕微鏡観察して測定したところ、 有機銀粒子は、長軸径0.5±0.05μm、短軸径 0. 4±0. 05μm、厚み0. 01μmの平板状粒子 が全有機銀粒子の90%である単分散度5%の粒子であ った。

ステアリン酸プチル

α-アルミナ(モース硬度9)

【0141】上記で作製した熱現像感光材料を、暗室内 で30cm幅で50mの長さに切断して内径10cmの ボール紙でできたコアに巻き付けロール形状の試料を作 製した。さらに暗室内で作製した試料を60cm×2m

【0142】実施例2

実施例1と同様にして作製した下引済みPET支持体に 以下の各層両面同時塗布し、熱現像感光材料を作製し た。なお、乾燥は60℃、15分間で行なった。

0.1g

0.1g

【0143】 (バック面側塗布) 支持体の下引上層B-2層の上に以下の組成の液を乾燥膜厚が6μmとなるよ うに同時塗布した。

[0144]

バインダー樹脂II (表1に記載) のラテックス (10質量%水溶液)

15 g 0.007g 染料-A 0.007g 染料-B マット剤:単分散度15%平均粒子サイズ5μm単分散シリカ 0.09g マット剤:単分散度15%平均粒子サイズ17μm単分散シリカ 0.01g 0.05g ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム 0.1g ステアリン酸

(バック層表面保護層の塗布) バックコート層の上に以 40 塗布した。

下の組成の液を乾燥膜厚が3.5μmとなるように同時

ポリビニルアルコール (10質量%水溶液) 15g

マット剤:単分散度15%単分散平均粒子サイズ5μmシリカ 0.5g

(シリカ全質量の1質量%のアルミニウムで表面処理)

マット剤:単分散度15%単分散平均粒子サイズ15μmシリカ

(シリカ全質量の1質量%のアルミニウムで表面処理)

0.1g ステアリン酸

(感光層面側塗布) 支持体の下引層A-2の上に以下の

0. 0 μ m になる様に塗布した。

組成の液を塗布銀畳が1.0g/m、乾燥膜厚が1 50 【0146】(ハロゲン化銀粒子Bの調製)水700m

0.04g

1にフタル化ゼラチン22gおよび臭化カリウム30mgを溶解して温度40℃にてpHを5.0に合わせた後、硝酸銀18.6gを含む水溶液159mlと臭化カリウムを含む水溶液をpAg7.7に保ちながらコントロールダブルジェット法で60分間かけて添加した。K、[IrCl。]を8×10-6モル/Lと臭化カリウムを1モル/Lで含む水溶液をpAg7.7に保ちながらコントロールダブルジェット法で30分かけて添加した。その後pH5.9、pAg8.0に調整した。得られたハロゲン化銀粒子Bは、平均粒子サイズ0.07 μ m、投影面積直径の変動係数8%、(100)面積率86%の立方体粒子であった。

【0147】上記ハロゲン化銀粒子Bを温度60℃に昇 テルル化合物-1 温して、銀1モル当たり8.5×10・モルのチオ硫酸ナトリウム、1.1×10・モルの2,3,4,5,6ーペンタフロロフェニルジフェニルスルフィンセレニド、2×10・モルのテルル化合物 -1、3.3×10・モルの塩化金酸、2.3×10・モルのチオシアン酸を添加して、120分間熟成した。その後、温度を50℃にして8×10・モルの増感色素Bを攪拌しながら添加し、更に、3.5×10・モルの沃化カリウムを添加して30分間攪拌し、30℃に急冷してハロゲン化銀乳10剤Bを調製した。

[0148] 【化23】

增感色素B

$$H_3CS$$
 $N+$
 $(CH_2)_{\overline{5}}COO^{-}$
 $(CH_2)_{\overline{5}}COOH$

【0149】(有機酸銀微結晶分散物の調製)ベヘン酸 40g、ステアリン酸7.3g、蒸留水500mlを9 0℃で15分間混合し、激しく攪拌しながら1モル/L のNaOH水溶液187mlを15分かけて添加し、1 モル/Lの硝酸水溶液 6 1 m l を添加して 5 0 ℃ に 降温 30 した。次に、1モル/Lの硝酸銀水溶液124mlを添 加してそのまま30分間攪拌した。その後、吸引濾過で 固形分を濾過し、濾水の伝導度が30μS/cmになる まで固形分を水洗した。こうして得られた固形分は、乾 燥させないでウェットケーキとして取り扱い、乾燥固形 分34.8g相当のウェットケーキに対して、ポリビニ ルアルコール12gおよび水150m1を添加し、良く 混合してスラリーとした。平均直径0.5mmのジルコ ニアビーズ840gを用意してスラリーと一緒にベッセ ルに入れ、分散機(1/4G-サンドグラインダーミ ル:アイメックス(株)社製)にて5時間分散し、体積 加重平均1.5 μmの有機酸銀微結晶分散物を得た。粒 子サイズの測定は、Malvern Instrume ntsLtd. 製MasterSaizerXにて行っ た。

【0150】 (固体微粒子分散物の調製) テトラクロロ

有機酸銀微結晶分散物 ハロゲン化銀粒子B バインダー樹脂I(表1に記載)固形分として 還元剤-1

フタル酸、4-メチルフタル酸、1,1-ビス(2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-3,5,5-トリメチルヘキサン、フタラジン、トリプロモメチルス ルホキノリンについて固体微粒子分散物を調製した。

【0151】テトラクロロフタル酸に対して、ヒドロキシプロピルセルロース0.81gと水94.2mlとを添加して良く攪拌してスラリーとして10時間放置した。その後、平均直径0.5mmのジルコニアビーズを100mlとスラリーとを一緒にベッセルに入れて有機酸銀微結晶分散物の調製に用いたものと同じ型の分散機で5時間分散してテトラクロロフタル酸の固体微結晶分散物を得た。固体微粒子の粒子サイズは70質量%が1.0μm以下であった。

【0152】その他の素材については所望の平均粒径を 40 得るために適宜分散剤の使用量および分散時間を変更し て、固体微粒子分散物を得た。

【0153】 (乳剤層塗布液の調製) 先に調製した有機 酸銀微結晶分散物に対して下記の各組成物を添加して乳 剤塗布液を調製した。

[0154]

0.95モル 0.05モル 430g 98g

特開	^	^	^	0	•	C	0	7	1	•
47 [11]	_	v	U		1	О	4	- (1	

(27)	特開2002-162713
51	52
トリプロモメチルスルホニルベンゼン	1 2 g
ヒドラジン誘導体(表1に記載の化合物)	1. 5 g
硬調化剤(表1に記載の化合物)	1. 5 g
フタラジン	9. 2 g
4 -メチルフタル酸	7 g
テトラクロロフタル酸	5 g
マット剤: 単分散度15%平均粒子サイズ5μm単分散	(シリカ
	2. 0 g
(シリカ全質量の1質量%のアルミニウムで表面処理)	
ステアリン酸	0.5g
ステアリン酸プチル	0. 5 g
αーアルミナ(モース硬度 9)	0. 5 g
(表面保護層) 以下の組成の液を感光層の上になるよう 【0155】	
同時塗布した。	
· 水	2 6 g
ベンジルメタクリレート/エチルアクリレート/アクリロ	コニトリル/
メタクリル酸=3/3/2/2 (Tg=45℃)	2. 3 g
フタラジン	0. 25g
還元剤-1	1 0 g
マット剤:単分散度15%単分散平均粒径5μmシリカ	0. 5 g
(シリカ全質量の1質量%のアルミニウムで表面処理)	
マット剤:単分散度15%単分散平均粒径20μmシリス	0.04g
(シリカ全質量の1質量%のアルミニウムで表面処理)	
$C_3 F_{17} - C_6 H_4 - S O_3 N a$	0. 02g
ステアリン酸	0. 1 g
ステアリン酸ブチル	0. 1 g

塗膜形成した後の試料を用い、バインダーを除去した後 に、レプリカ法で電子顕微鏡観察して測定したところ、 有機銀粒子は、長軸径0.5±0.05μm、短軸径 0. 4±0. 05μm、厚み0. 01μmの平板状粒子 が全有機銀粒子の90%である単分散度5%の粒子であ った。

 α -アルミナ (モース硬度9)

【0156】上記で作製した熱現像感光材料を、暗室内 で30cm幅で50mの長さに切断して内径10cmの ボール紙でできたコアに巻き付けロール形状の試料を作 製した。さらに暗室内で作製した試料を60cm×2m の包装材料で巻いた。

【0157】《露光及び現像処理》実施例1及び2で作 製した試料1~22を、780nmの半導体レーザーを 40 搭載したイメージセッター機であるサイテックス社製D olev 2dryを用いて300線で5%刻みで露光 量変化させるように網点を露光し、110℃で15秒の プレヒート部を通過させた後、オーブン中で水平搬送を 行ないつつ120℃で15秒の熱現像を行った。その 際、露光及び現像は23℃、50%RHに調湿した部屋 で行った。この時、熱現像処理機中の最長非接触搬送長 は18cmであった。また熱現像処理機の搬送速度は表 2に記載の値であった。

【0158】 (ガンマァ) 特性曲線の濃度0.3と3.

0を結ぶ直線の傾きを脚切れを表す階調(γ)とした。 【0159】(Dmax)得られた画像の評価を濃度計 により行ない、最高濃度部の値をDmaxとした。

0.1g

【0160】(カブリ)得られた画像の評価を濃度計に より行ない、最低濃度部の値をDmin(カブリ)とし

【0161】 (黒ポツ) 得られた画像の黒ポツの個数を 目視でカウントした。

【0162】(接着性)フィルム上にセロテープ(登録 商標)をはり、碁盤目上に傷を入れ、テープ剥離後には がれた部分の面積比率を求め、5段階で評価した。

[0163]

5:剥離部分 0%

4:剥離部分 1~33%

3:剥離部分 34~66%

2:剥離部分 67%~99%

1:剥離部分 100%。

【0164】尚、試料18は、PETフィルムを搬送熱 処理する際の張力を9. 8×10'Pa(=10.0k g/cm²) に、画像記録層中のバインダー樹脂I及び 下引層中のバインダー樹脂!!を表1のように変更した以 外は試料1と同様にして作製した。

50 【0165】結果を表2に示す。

[0166]

【表1】

試料 No.	感材の種類	ヒドラジン 誘導体	硬調化剤	画像記録層中の バインダー樹脂! (質量比率)	バックコート層中の バインダー樹脂 II	下引き層中の バインダー樹脂 III
1	実施例1	H-1-1	A 1	H/A=70/30	J/A=90/10	D
2	実施例1	H-1-1	A 1	H/B = 70/30	J/B = 90/10	D
3	実施例 1	H-1-1	A 1	H/D = 70/30	J/D=90/10	D
4	実施例 1	H-1-1	A 1	H/F = 70/30	J/F = 90/10	D
5	実施例1	H-1-1	A 1	H/B = 70/30	J/B=90/10	G
6	実施例 1	H-1-1	A 1	H/B = 70/30	J/8 = 90/10	В
7	実施例 1	H-2-1	A 1	H/A=70/30	J/A=90/10	D
8	実施例1	H-3-1	A 1	H/A = 70/30	J/A = 90/10	D
9	実施例 1	H-4-1	A 1	H/A=70/30	J/A=90/10	D
10	実施例1	H-1-1	B 1	H/A=70/30	J/A = 90/10	D
11	実施例 1	H-1-1	Cl	H/A=70/30	J/A=90/10	D
12	実施例1	H-1-1	D 1	H/A = 70/30	J/A=90/10	D
13	実施例 2	H-1-1	A 1	E/A=70/30	K/A = 90/10	D
14	実施例 2	H-1-1	A 1	E/B = 70/30	K/B=90/10	D
15	実施例 2	H-1-1	A 1	E/D = 70/30	K/0 = 90/10	D
16	実施例2	H-1-1	A 1	I/F=70/30	K/F = 90/10	D
17	実施例1	H-1-1	A 1	H/C = 70/30	J/C=90/10	D
18	実施例1	H-1-1	A 1	H/E = 70/30	J/E=90/10	D
19	実施例1	H-1-1	A 1	H/G = 70/30	J/G=90/10	D
20	実施例1	なし	なし	H/C = 70/30	J/F=90/10	D
21	実施例 1	H-1-1	A 1	H/A = 70/30	J/A = 90/10	D
22	実施例1	H-1-1	A 1	H/A = 70/30	J/A = 90/10	D

[0167]

【表2】

B. Biles						接着性	接着性	搬送速度	備考	1
試料	感材の種類	黒ポツ	カブリ	Dmax	7	(画像記録層側)	(バックコート層側)	mm/sec	備考	l
No.					15.0	3.5	4	35	本発明	1
	実施例1	2	0.05	4.5	15.0		5	35	本発明	
2	実施例1_	2	0.05	4.2	14.8	5		35	本発明	
3	実施例1	3	0.06	4.0	14.6	5	5	35	本発明	
4	実施例1	3	0.07	4.0	14.6	3.5	4			
5	実施例1	2	0.05	4.2	14.7	4.5	4.5	35	本発明	
6	実施例1	2	0.05	4.2	14.7	5	5	35	本発明	
7	実施例:	3	0.06	4.3	14.8	3.5	4	35	本発明	
8	実施例1	2	0.06	4.5	15.0	3.5	4	35	本発明	
9	実施例1	3	0.05	4.4	14.9	3.5	4	35	本発明	
10	実施例 1	3	0.06	4.3	14.7	3.5	4	35	本発明	
111	実施例!	3	0.06	4.3	14.7	3.5	4	35	本発明	
1		3	0.07	4.2	14.5	3.5	4	35	本発明	1
12	実施例1	0	0.03	4.8	15.3	4	4.5	35	本発明	∄]
13	実施例 2	1 0		4.6	15.1	5	5	35	本発明	╗
14	実施例 2	 	0.03			5	5	35	本発明	打
15	実施例 2		0.04	4.4	15.0	4	4.5	35	本発明	
16	実施例 2_	2	0.05	4.4	15.0		2	35	比較	
17	実施例1	10	0.11	3.5	12.5	2		35	比較	7
18	実施例 1	14	0.11	3.3	12.0	2	2		比較	
19	実施例 1	20	0.1	3.1	11.8	2 .	2	35	LL #7	ř
20	実施例1	2	0.1	2.1	8.3	2	4	35	比較	ž.
21	実施例 1	15	0.11	4.4	14.9	3	4	20	比軟	Ÿ,
22	実施例1	3	0.05	3.3	12.4	3.5	4	45	比	<u>Q</u> _

【0168】表1で使用したバインダーを下記に示す。 A:-SO₃Na含有ポリウレタン(ジフェニルメタン ジイソシアネート/ネオペンチルグリコール/アジピン 酸/1、6ヘキサンジオール=13/16/40/31 (モル%): Tg=-22℃)

B:ポリカプロラクトン含有ポリウレタン(ジフェニル メタンジイソシアネート/ネオペンチルグリコール/シ クロヘキサンジメタノール/イソフタル酸/フタル酸/ エチレングリコール/ポリカプロラクトン=13/1650 D: $-SO_1Na$ 含有アクリル樹脂(2-ヒドロキシエ

/14/14/8/2/33 (モル%): Tg=23 C)

C:-SO₃ Na含有シクロヘキサン環含有ポリウレタ ン (ジフェニルメタンジイソシアネート/ネオペンチル グリコール/シクロヘキサンジメタノール/イソフタル 酸/フタル酸/エチレングリコール=11/22/22 /28/14/3を原料とするポリウレタン: Tg=70°C)

チルメタクリレート/メチルメタクリレート=50/50 (モル%): Tg=40℃)

E:-SO, Na含有アクリル樹脂(2-ヒドロキシエチルメタクリレート/メチルメタアクリレート=25/75(モル%): Tg=70 \mathbb{C})

F:-SO₃ Na含有ポリエステル(商品名バイロン5

30/東洋紡製:Tg=5℃)

G:ポリエステル(商品名バイロン200/東洋紡製: Tg=70℃)

H: -SO, K含有ポリビニルブチラール (Tg=65 ℃)

I: ラクスター3307B (大日本インキ化学工業製: Tg=13℃) J:セルロースアセテートプチレート (Tg=140°C)

K:-SO, Na含有アクリル樹脂(フェニルメタクリレート/4-ヒドロキシフェニルメタクリルアミド/3-シアノフェニルメタクリルアミド=30/40/30(モル%)であるアクリル樹脂: Tg=110 で、表2から、本発明の試料は、黒ポツやカブリが良好で接着性に優れ、Dmaxが高く硬調な熱現像感光材料であることが判る。

10 [0169]

【発明の効果】本発明により、黒ポツやカブリが良好で接着性に優れ、Dmaxが高く硬調な熱現像感光材料が得られる。